

- (19) Japan National Patent Agency (JP)
(12) Official Gazette for Kokai Utility Model Applications (U)
(11) Utility Model of the Kokai Application No. : JP1986-50631
(43) Kokai Publication Date: April 5th 1986

Total Pages: 1
Request for Examination: Not Submitted

(51) Int. Cl. ⁴	Identification	Internal Organization Number
B 23Q 3/08		A- 7041-3C
B24B 7/16		7512-3C
37/04		7712-3C
41/06		8308-3C

(54) Title of Device: VACUUM CHUCK

(21) Utility Application No: JP1984-135757

(22) Date of Application: September 7th 1984

(71) Applicant: NIPPON ELECTRIC CORPORATION
5-33-1 Shiba,
Minato-ku, Tokyo

(72) Creator: MICHIO ISHIKAWA
NIPPON ELECTRIC CORPORATION
5-33-1 Shiba,
Minato-ku, Tokyo

(74) Agent HITOSHI UCHIHARA, Patent Attorney

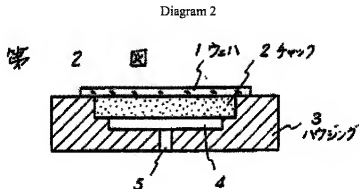
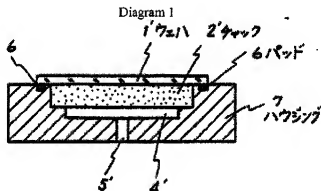
(57) Claim for Registration of the Utility Model

This is a vacuum chuck wherein comprised by maintaining the work piece [sic] with the vacuum chuck, and supplying and processing the chemical polishing liquid while sliding the work piece on the surface of the polishing cloth, the vacuum chuck in the non-distorting mirror polishing device creates a belt shaped elastic pad on the vacuum surface that faces the peripheral part of the work piece, and is structured to prevent the chemical polishing liquid to include the surrounding surface of the back of the work piece.

[A Simple Explanation of the Drawing]

Diagram 1 is an explanation of one embodied example of the wafer chuck structure for the non-distorting mirror polishing device of this conception. Diagram 2 is an explanatory drawing of one example of the wafer chuck for the conventional non-distorting mirror polishing device.

According to the drawing, 1 and 1' is the wafer, 2 and 2' is the chuck, 3 is the housing, 4 is the hollow part, 5 is the suction hole, 6 is the pad and 7 illustrates the housing that which pad 6 is buried in.



⑤ 公開実用新案公報(U) 昭61-50631

⑥ Int. Cl.

B 23 Q 3/08
B 24 B 7/16
37/04
41/06

識別記号

庁内整理番号

A-7041-3C
7512-3C
7712-3C
8308-3C

⑦ 公開 昭和61年(1986)4月5日

審査請求 未請求 (全1頁)

⑧ 考案の名称 真空チャック

⑨ 実 願 昭59-135757

⑩ 出 願 昭59(1984)9月7日

⑪ 考 案 者 石 川 通 夫 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑫ 出 願 人 日 本 電 気 株 式 会 社 東京都港区芝5丁目33番1号

⑬ 代 理 人 弁 理 士 内 原 晋

⑭ 実用新案登録請求の範囲

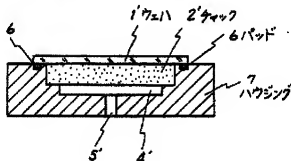
真空チャックにより被加工物を吸着保持し、研磨布面上で該被加工物を揺動運動させながら化学研磨液を供給して加工する無歪鏡面研磨装置における真空チャックにおいて、被加工物の外周部分に対向した真空チャック面上に帯状の弾性体パッドを形成し、被加工物表面への化学研磨液の回り込みを防止した構造とすることを特徴とする真空チャック。

図面の簡単な説明

第1図は本考案の無歪鏡面研磨装置のウエハチャック構造の一実施例を説明する図、第2図は、従来の無歪鏡面研磨装置のウエハチャックの一例を説明する図である。

図において、1と1'はウエハ、2と2'はチャック、3はハウジング、4は中空部、5は吸引穴、6はパッド、7はパッド6を挿込んだハウジングを示す。

第 1 図



第 2 図

